

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成20年11月20日(2008.11.20)

【公開番号】特開2006-131632(P2006-131632A)

【公開日】平成18年5月25日(2006.5.25)

【年通号数】公開・登録公報2006-020

【出願番号】特願2005-317957(P2005-317957)

【国際特許分類】

C 07 C 67/04 (2006.01)

C 07 C 69/15 (2006.01)

【F I】

C 07 C 67/04

C 07 C 69/15

【手続補正書】

【提出日】平成20年10月7日(2008.10.7)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

酢酸ビニル反応器に供給されるエチレン含有ガスを酢酸で飽和するにあたり、酢酸ビニルプロセスで回収された酢酸を塔に導入し、そこで、その塔底から供給されたエチレン含有ガスを酢酸で飽和させる方法であって、前記塔が向流式ストリッピング部及び精留部を有し、前記回収酢酸は前記向流式ストリッピング部及び／または精留部に導入され、かつ新鮮な酢酸が精留部に導入され、及び塔から抜かれる液体は二つの部分流に分割され、そのうちの一つの部分流は、酢酸による十分な飽和に必要な最小ポンプ循環流量を維持しながら、塔にポンプ返送され、この際、この部分流は、安全性に関連して監視されかつ塔に流入する前に、熱交換器で加熱され、かつこの熱交換器には、少なくとも一つの更に別の熱交換器が並行に配置されており、他方で、残りの他の部分流は排出される、ことを特徴とする前記方法。